



CMOS射频集成电路设计

2009年3月11日

唐长文 副教授

zwtang@fudan.edu.cn

http://www.rfic.fudan.edu.cn/Course.htm

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

版权© 2005-2009, 版权所有, 侵犯必究

片上螺旋电感



- 射频集成电路中的电感
- 片上螺旋电感
- 平面螺旋电感的分析和建模
- 等效电容的计算
- 提高品质因数的几种方法
- 片上电感的在片测试
- 中心抽头差分电感的等效模型和参数提取

简介

 射频集成电路的市场潜力 □无线收发机: WLAN, Bluetooth, WCDMA, TD-SCDMA □宽带调谐器: Mobile Tuner, DVB-T TV Tuner CMOS技术的发展 □工作频率<10GHz,截止频率30-50GHz □比GaAs, SiGe, Bipolar工艺便宜 □高集成, 高性能 ◆数字和模拟 ◆有源和无源器件: MOS, 二极管, 电阻, 电容, 电感 ●设计电感能否像MOS管一样方便? □建模是难点 □品质因数Q的优化和自激振荡频率f_{RS}的优化

片上电感的三种类型





图3 片上螺旋电感

(a) 单端结构, (b) 双端结构 复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

射频集成电路中的电感())

●射频集成电路

□低噪声放大器, 混频器, 压控振荡器, 功率放大器, 高频 带通滤波器和阻抗匹配网络



图1 低噪声放大器

图2 频混频器

为了提高增益(转换增益),增大片上电感的等效并联电阻。



压控振荡器电路与版图照片

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

- 为了提高品质因数,降低片 上电感的串联电阻。
- 为了提高压控振荡器的调谐
 范围,减小并联电容。



射频集成电路中的电感(II)

• 片上电感的功能和作用

电路	功能	作用		
低噪声放大器	输入阻抗匹配	同时满足功率和噪声的匹配		
	源极退化	提高线性度		
	谐振负载	线性度最佳偏置,滤波,消除寄 生电容的影响		
混频器	源极退化	增加线性度,减小噪声		
振荡器	谐振	确定振荡频率,高品质因数电路 降低功耗,减小相位噪声		
功率放大器	功率匹配	增大电压摆幅,提高功率效率		
	谐振负载			

片上螺旋电感

• CMOS工艺互连线



CMOS工艺互连线剖面图



• 横向参数 □圈数,n □金属宽度, w □金属间距, S □外直径, d_{out} 内直径, **d**_{in} 填充率, $\rho = (d_{out} - d_{in}) / (d_{out} + d_{in})$ □边数,N







(b) 六边形





平面螺旋电感





方形电感的垂直参数



- 对称螺旋电感
- •非等宽螺旋电感









(C) 非等宽方形电感

其他平面螺旋电感

(b) 对称圆形电感

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

多层叠成螺旋电感



-12-

片上螺旋电感的分析与建模

- 电感的仿真与建模
 - □电磁场仿真工具
 - □分段电路模型
 - □精简集总电路模型



Frequency

片上电感的典型频响特性

(1)电磁场仿真工具

- Maxwell方程求解器 □Ansoft, EM-Sonnet, Momentum, Microwave Office
- 优点
 - □高精度,可用于任何结构分布系统的仿真
- 缺点
 - □速度非常慢
 - □需要大量内存进行计算
 - □软件非常昂贵
 - □对于SPICE仿真来说,模型非常复杂

(2)分段电路模型(I)

 对于片上电感的每一条金属建立分段π模型 Cf1 to adjacent coupled to all Cf2 segment nodes segments R K Ср Ср insulator capacitance coupled to image current Rsub Zin,seg Cs : Cs Gs. substrate modeling nth segment ┸ ᆂ

片上电感的每一段金属的两端等效模型

分段电路模型(II)

• 单圈分段模型



单圈分段等效模型

分段电路模型(III)

•耦合微带线模型



图1 平行微带线的耦合

图2 两根金属间的几种耦合方式

分段电路模型(IV)

• π模型方程

	Equation
$L = 2l\{ln[2l/(w+t)] + 0.50049 + (w+t)/3l\}$	(1)
$R = R_{sh} l / w$	(2)
$C_p = \varepsilon_0 \varepsilon_r w / h$	(3)
M = 2lU	(4)
$K_m = M_{I,2} / \sqrt{L_I L_2}$	(5)
$2M = (M_{l+m\pm\delta} + M_{\delta}) - (M_{l\pm\delta} + M_{m\pm\delta})$	(6)
$2M = (M_{m+p} + M_{m+q}) - (M_{p} + M_{q})$	(7)
$M_{lm} = 2\cos\phi \left[l \tanh^{-l} \left(\frac{m}{l+y} \right) + m \tanh^{-l} \left(\frac{l}{m+y} \right) \right]$	(8)
$M_{lm} = 2\cos\phi \left[\left(M_{\mu+l,\nu+m} + M_{\mu\nu} \right) - \left(M_{\mu+l,\nu} + M_{\nu+m,\mu} \right) - \Omega d_z / \sin\phi \right]$	(9)
$\Omega = \frac{\pi}{2} + \tan^{-l} \left[\frac{d_z^2 \cos\phi + \ln \sin^2 \phi}{d_z R_l \sin\phi} \right] - \tan^{-l} \left(\frac{d_z \cos\phi}{l \sin\phi} \right) - \tan^{-l} \left(\frac{d_z \cos\phi}{m \sin\phi} \right)$	(10)
$R_{sub} = \rho_{si} l / (wh_{si})$	(11)
$C_{s} = \frac{(w + \Delta w')}{h} \varepsilon_{0} \varepsilon_{r_{s} S_{t}}, \ \Delta w' = \left(1 + \frac{l}{\varepsilon_{r_{s} S_{t}}}\right) \frac{\Delta w}{2}, \ \Delta w = \frac{t}{\pi} ln \left[4e / \sqrt{\left(\frac{t}{h}\right)^{2} + \left(\frac{l/\pi}{w/t + l.1}\right)^{2}}\right]$	(12)
$G_s = \hat{\sigma} \frac{w}{\hat{h}}, \ \hat{\sigma} = \sigma \left(\frac{l}{2} + \frac{l}{2\sqrt{l+10h/w}} \right), \ \hat{h} = \frac{w}{2\pi} log \left(\frac{8h}{w} + \frac{4w}{h} \right)$	(13)
系统国家重点实验室	唐长文



• 优点

□与电磁场仿真工具相比,非常简单 □易于与SPICE软件进行集成



□SPICE网表比较复杂、繁琐 □模型中器件数目太多,降低了SPICE仿真的速度

(3)精简集总电路模型(I)

●简单,模型中的电阻和电容有明确物理意义
 □串联电阻R_s

$$R_{\rm s} \approx \frac{l}{\sigma W \delta(1 - e^{(\frac{-t}{\delta})})}$$

 σ 是电导率,t为金属厚度 δ 是趋肤深度 $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}$

□金属 – 衬底间氧化层电容
$$C_{ox1} \approx C_{ox2} \approx \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} I W$$

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室





9-元件精简集总电感模型 唐长文

精简集总电路模型(Ⅱ)

□串通电容Cs

$$C_{\rm s} \approx \frac{\mathcal{E}_{\rm ox}}{t_{\rm ox,M1-M2}} NW^2$$

$$C_{si1} \approx C_{si2} \approx \frac{1}{2} C_{sub} / W$$

□衬底电阻

$$R_{si1} \approx R_{si2} \approx \frac{2}{G_{sub}/W}$$

平面螺旋电感的简单精确表达式(1)

• 电流块近似表达式 □UC Berkeley, Mohan提出的 $L_{cursh} = \frac{\mu n^2 d_{avg} c_1}{2} [\ln(c_2/\rho) + c_3 \rho + c_4 \rho^2]$ µ是磁介质常数, n为圈数 $d_{avg} = 0.5(d_{out} + d_{in})$ $\rho = (d_{out} - d_{in})/(d_{out} + d_{in})$



Layout	c_1	c_2	c_3	c_4
Square	1.27	2.07	0.18	0.13
Hexagonal	1.09	2.23	0.00	0.17
Octagonal	1.07	2.29	0.00	0.19
Circle	1.00	2.46	0.00	0.20

电流块近似表达式中的系数

电流块近似

平面螺旋电感的简单精确表达式(II)

• 数据拟合多项式

□数据拟合技术

$$\boldsymbol{L}_{mon} = \beta \boldsymbol{d}_{out}^{\alpha_1} \boldsymbol{\omega}^{\alpha_2} \boldsymbol{d}_{avg}^{\alpha_3} \boldsymbol{n}^{\alpha_4} \boldsymbol{s}^{\alpha_5}$$

Layout	β	$lpha_1~(d_{ m out})$	$\alpha_2(w)$	$lpha_3~(d_{ m avg})$	α_4 (n)	$\alpha_5(s)$
Square	$1.62 \cdot 10^{-3}$	-1.21	-0.147	2.40	1.78	-0.030
Hexagonal	$1.28 \cdot 10^{-3}$	-1.24	-0.174	2.47	1.77	-0.049
Octagonal	$1.33 \cdot 10^{-3}$	-1.21	-0.163	2.43	1.75	-0.049

多项式中的系数

□如何拟合

所有变量采用对数形式表示 $X_1 = \log d_{out} X_2 = \log \omega X_3 = \log d_{avg} X_4 = \log n X_5 = \log s$ 最小均方差拟合

目标函数:

$$\sum_{k=1}^{N} (y^{(k)} - \alpha_0 - \alpha_1 x_1^{(k)} - \alpha_2 x_2^{(k)} - \alpha_3 x_3^{(k)} - \alpha_4 x_4^{(k)} - \alpha_5 x_5^{(k)})^2$$

平面螺旋电感的简单精确表达式(II)

● 改进型Wheeler公式
 □首先由H.Wheeler提出
 □UC Berkeley, Mohan进行了改进
 L_{mw} = K₁µ₀ n²d_{avg}/(1+K₂ρ)

系数K1和K2是与版图有关的系数, P是填充系数

Layout	K_1	K_2
Square	2.34	2.75
Hexagonal	2.33	3.82
Octagonal	2.25	3.55

改进型Wheeler公式中的系数

优缺点

• 优点

- □精简、集总电路模型,简单、通用且稳定
- □具有物理意义
- □非常容易与SPICE软件集成: 电路仿真和优化的最佳选择
- 缺点
 - □模型与工作频率有关,不适合宽频带应用

等效电容的计算

●什么是片上电感的等效电容?
 □在自激频率点,磁场能力峰值与电场能量峰值相等
 □给定电压峰值V₀,电场能量为 C_{eq}V₀²/2

● 第一自激振荡频率f_{SR}

$$f_{SR} = \left(2\pi\sqrt{L_{eq}C_{eq}}\right)^{-1}$$

• 等效电容模型

□金属层间电容: C_{M-M}
 □金属与衬底间电容: C_{M-S}

一些假设条件

- ●每圈线圈的几何参数是相同的
 □宽度: w
 □厚度: t
 □长度: |
- ●每圈线圈的电学参数是相同的
 □金属电导率: *P* □电流: i

版权© 2005-2009, 版权所有, 侵犯必究

金属层间电容: C_{M-M}

• 电场能量





金属层间的分布电容和电压压降图

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

金属与衬底间电容: C_{M-S}

●电场能量 $E_{e,C_m} = \frac{1}{2}C_m V_{C_m}^2 = \frac{1}{2} \frac{C_{M_n - S} W I}{N} (V_1 - \frac{m}{N} \Delta V)^2$ $E_{e,C} = \sum_{i=1}^{N} E_{e,C_{m}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} C_{m} V_{C_{m}}^{2} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} \frac{C_{M_{n}-S} W I}{N} (V_{1} - \frac{m}{N} \Delta V)^{2} \approx \frac{1}{6} C_{M_{n}-S} W I \left\{ V_{1}^{2} + V_{2}^{2} + V_{1} V_{2} \right\}$ **Substrate**

金属与衬底间的分布电容和电压压降图

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

版权© 2005-2009, 版权所有, 侵犯必究

叠成电感(Stacked)的等效电容



n圈2层叠成电感和电压压降图

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

电容系数

● K1为金属间电容系数 ● K2为金属与衬底间电容系数 $C_{eq} = \kappa_1 C_1 + \kappa_2 C_2$ $C_{1} = C_{M_{n}-M_{n-1}} W \cdot \sum_{k=1}^{n} I_{k} \quad C_{2} = C_{M_{n}-S} W \cdot \sum_{k=1}^{n} I_{k} \quad I_{k} = N \cdot tg(\frac{\pi}{N})[d_{in} + 2(n-k)p]$ $\rho_{p} = p/d_{ip} = (w+s)/d_{ip}$ $\kappa_{1} = \frac{1}{\left(n\left[1+(n-1)\rho_{p}\right]\right)^{3}} \sum_{m=1}^{n} \left[1+2(n-m)\rho_{p}\right] \left((n-m+\frac{1}{2})+(n-m)^{2}\rho_{p}\right)^{2}$ $K_2 = \frac{1}{12}$

版权© 2005-2009,版权所有,侵犯必究

3D叠成电感的等效电容



n圈2层3D叠成电感和电压压降图

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

电容等效系数

$$\kappa_{1} = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{n} \left(\frac{I_{m}}{2\sum_{k=1}^{n} I_{k}}\right)^{3} = \frac{1}{4} \sum_{m=1}^{n} \left(\frac{d_{in} + 2(n-m)p}{n\left[d_{in} + (n-1)p\right]}\right)^{3}$$

$$\kappa_{2} = \frac{1}{12\left(n\left[1+(n-1)\rho_{p}\right]\right)^{3}}\sum_{m=1}^{n}\left(1+2(n-m)\rho_{p}\right)\left\{\left(2(n-m+1+\frac{\left[-1+(-1)^{m}\right]}{4})+(n-m)(2n-2m+1+(-1)^{m})\rho_{p}\right)^{2}+\left(2(n-m+1+\frac{\left[-1+(-1)^{m}\right]}{4})+(n-m)(2n-2m-1+(-1)^{m})\rho_{p}\right)^{2}+\left(2(n-m+1+\frac{\left[-1+(-1)^{m}\right]}{4})+(n-m)(2n-2m-1+(-1)^{m})\rho_{p}\right)^{2}\right\}$$

版权© 2005-2009, 版权所有, 侵犯必究

比较



提高品质因数的几种方法

- 电场地屏蔽层
- 多路径分割
- ●深阱双反偏pn结隔离



图3 深阱双反偏PN结隔离

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室



图1 电场地屏蔽层



图2 多路径分割

PGS地屏蔽层结构





PGS Groud shielded substrate loss

版权© 2005-2009, 版权所有, 侵犯必究

片上电感的在片测试

Network Analyzer











复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

OPEN-SHORT去嵌入



OPEN-THRU去嵌入



宽频带电感

单π宽带模型

[J. Kino, VLSI Symp. 2004]

双π宽带模型

[Y. Cao, JSSC. March 2003]







• 单端口阻抗模型:端口1或者端口2接地



• 等效单端串联电感 $L_s = \frac{Im(Z_1)}{2\pi f}$ • 等效单端串联电阻 R_s $R_s = Re(Z_1)$ • 单端串联品质因数 $Q_{se} = \frac{Im(Z_1)}{Re(Z_1)}$





唐长文

RLQ单端等效参数提取(II)

• 双端口单 π Y模型



• 等效单端串联电感 $L_s L_s = \frac{\text{Im}(1/Y_{11})}{2\pi f}$ or $L_s = \frac{\text{Im}(-1/Y_{12})}{2\pi f}$ • 等效单端串联电阻 $R_s R_s = \text{Re}(1/Y_{11})$ or $R_s = \text{Re}(-1/Y_{12})$ • 单端串联品质因数 Q_{se} $Q_{se} = \frac{\text{Im}(1/Y_{11})}{\text{Re}(1/Y_{11})}$

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

RLQ单端等效参数提取(III)



复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室



• 差分激励Y参数

$$Z_{diff} = \left(-\frac{1}{Y_{12}}\right) \left\| \left(\frac{1}{Y_{11} + Y_{12}} + \frac{1}{Y_{22} + Y_{12}}\right) + \frac{Y_{11} + Y_{22} + 2Y_{12}}{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}^2}\right) + \frac{Y_{11} + Y_{22} + 2Y_{12}}{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}^2}$$
• 等效差分串联电感L_s

$$L_{s} = \frac{lm(Z_{diff})}{2\pi f}$$



复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

 $\begin{aligned} R_{\rm s} &= {\rm Re}\big(Z_{\rm diff}\,\big) \\ Q_{\rm diff} &= \frac{{\rm Im}\big(Z_{\rm diff}\,\big)}{{\rm Re}\big(Z_{\rm diff}\,\big)} \end{aligned}$



• 差分激励Z参数

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ -i_1 \end{bmatrix}$$

$$Z_{\text{diff}} = \frac{V_1 - V_2}{i_1} = Z_{11} + Z_{22} - Z_{12} - Z_{21}$$
• 等效差分串联电感Ls

$$L_s = \frac{\text{Im}(Z_{\text{diff}})}{2\pi f}$$



等效差分串联电阻R_s
 差分串联品质因数Q_{diff}

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

 $R_{\rm s} = {\rm Re}(Z_{\rm diff})$ $Q_{\rm diff} = \frac{{\rm Im}(Z_{\rm diff})}{{\rm Re}(Z_{\rm diff})}$

 $R_{\rm s} = {\rm Re}(Z_{\rm diff})$

RLQ差分等效参数提取(III)

●等效差分串联电阻**R**s

● 差分串联品质因数Q_{diff}

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

唐长文

 $Q_{\rm diff} = \frac{\rm Im(Z_{\rm diff})}{\rm Re(Z_{\rm diff})}$





非对称电感RLQS曲线





















RLC并联谐振网络品质因数



RLC串联谐振网络品质因数



中心抽头差分电感



• 中心抽头差分电感应用场合

□采用中心抽头差分电感的压控振荡器的谐振网络

□用于正交压控振荡器中的源极二次谐波耦合

□全差分低噪声放大器和混频器的负载谐振网络



• 单端口S参数测量

$$Z_{in} = Z_0 \left(\frac{1+S_{i1}}{1-S_{i1}} \right)$$

□端口2开路
□端口2矩路

$$j\omega L_{1}i_{1} - j\omega Mi_{2} = u_{1} \qquad L_{1} = L_{2} = L$$
$$-j\omega Mi_{1} + j\omega L_{2}i_{2} = 0 \qquad L_{1} = L_{2} = L$$
$$Z_{in1} = \frac{u_{1}}{i_{1}} = j\omega L \left(1 - \frac{M^{2}}{L^{2}}\right) = j\omega L \left(1 - k^{2}\right)$$



宽带180°相移网络的双端口S参数测量



$$j\omega L_1 i_1 - j\omega M i_2 = u_1 \qquad L_1 = L_2 = L$$
$$-j\omega M i_1 + j\omega L_2 i_2 = u_2 \qquad u_2 = -u_1$$

$$Z_{\rm in1} = \frac{U_1}{I_1} = j\omega L(1+k) = j\omega (L+M)$$

$$Z_{\rm in2} = \frac{u_2}{i_2} = j\omega L(1+k) = j\omega(L+M)$$

复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

- -

中心抽头等效模型

• 集总电路模型



去耦等效集总电路模型



-57-

差分激励等效模型

• 差分激励的交流等效模型



• 中心抽头等效模型



复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室

差分激励单端阻抗和差分阻抗

• 单端阻抗

$$R_{\rm se} + jX_{\rm se} = rac{1}{Y_{11} - Y_{12}}$$

• 差分阻抗

$$R_{diff} + jX_{diff} = \left(-\frac{1}{Y_{12}}\right) \left\| \left(\frac{1}{Y_{11} + Y_{12}} + \frac{1}{Y_{22} + Y_{12}}\right) = \frac{Y_{11} + Y_{22} + 2Y_{12}}{Y_{11}Y_{22} - Y_{12}^{2}} \right) \right\|$$
• **RLQ**参数提取

$$R_{eff} = \operatorname{Re}[R + jX] \quad L_{eff} = \frac{\operatorname{Im}[R + jX]}{2\pi f} = \frac{2}{Y_{11} - Y_{12}} \left(\frac{Y_{11} = Y_{22}}{Y_{11} - Y_{12}} \right)$$

中心抽头等效模型的验证

- 0.35 um 1P4M RF Mixed-signal Process
- 第一、二层金属的并联再与第三、四层金属的并联相串联
- M1, M2和M3厚度为0.64 um, M4厚度为0.895 um







考文献(I)

- 博士论文
 - Sunderarajan S. Mohan, "The design, modeling and optimization of on-chip inductor and transformer circuits," Ph. D. Dissertation, Stanford University, Dec. 1999.
 - C. P. Yue, "On-chip spiral inductors for silicon-based Radio-frequency integrated circuits", Ph. D. Dissertation, Stanford University, Jun. 1998.
 - □ 唐长文,"电感电容压控振荡器",2004年5月,复旦大学博士学位论文

• 软件

- ASITIC: Analysis and Simulation of Spiral Inductors and Transformers for ICs, http://rfic.eecs.berkeley.edu/~niknejad//asitic.html.
- □ Agilent Momentum
- □ Microwave Office

参考文献(II)

杂志文章

- Y. K. Koutsoyannopoulos and Y. Papananos, "Systematic analysis and modeling of integrated inductors and transformers in RF IC design," *IEEE Trans. Circuits and Systems, II, Analog and Digital Signal Processing,* vol.47, pp.699-713, Aug. 2000.
- □ J. R. Long and M. A. Copeland, "The modeling, characterization, and design of monolithic inductors for silicon RF IC's," *IEEE Journal of Solid State Circuits*, vol. 32, pp.357-369, Mar. 1997.
- A. Zolfaghari, A. Chan and B. Razavi, "Stacked inductors and transformers in CMOS technology," *IEEE Journal of Solid State Circuits*, vol.36, pp.620-628, April. 2001.
- □ C.-C. Tang, C.-H. Wu and S.-I. Liu, "Miniature 3-D inductors in standard CMOS process," *IEEE Journal of Solid State Circuits,* vol.37, pp.471-480, April. 2002.
- S. S. Mohan, M. D. M. Hershenson, S. P. Boyd, T. H. Lee, "Simple accurate expressions for planar spiral inductances," *IEEE Journal of Solid State Circuits*, vol. 34, pp. 1419-1424, Oct. 1999.
- □ Jenei, S.; Nauwelaers, B.K.J.C.; Decoutere, S. "Physics-based closed-form inductance expression for compact modeling of integrated spiral inductors", *IEEE Journal of Solid State Circuits*, vol. 37, pp. 77-80, Jan. 2002.
- C. P. Yue, S. S. Wang, "On-chip spiral inductors with patterned ground shields for Si-based RF IC's," *IEEE Journal of Solid State Circuits*, vol. 33, pp. 743-751, May 1998.
- □ 卢磊,周锋,唐长文,闵昊,王俊宇,"中心抽头差分电感的等效模型和参数提取",半导体学报,2006年,第十二期,第27卷,第2150-2154页。
- 复旦大学 专用集成电路与系统国家重点实验室